科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

平成 28年 6月 16日現在

機関番号: 3 2 6 2 1
研究種目: 基盤研究(C)(一般)
研究期間: 2013~2015
課題番号: 2 5 4 2 0 8 2 0
研究課題名(和文)マイクロ波加熱によって発生するホットスポットの生成メカニズムとその制御
研究課題名(英文)Generation mechanism and control in hot-spot on heterogeneous catalyst under microwave heating
研究代表者
堀越 智(HORIKOSHI, Satoshi)
上智大学・理工学部・准教授
研究者番号:5 0 4 2 4 7 8 4
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,000,000円

研究成果の概要(和文): 1990年代後半より、マイクロ波を用いた有機合成の研究が盛んに行われている。中でも、 金属触媒を用いた化学合成は著しい促進効果が示唆されており、グリーンケミストリー的な位置づけからも重要な技術 である。一方、マイクロ波による金属触媒能の促進理由(メカニズム)については様々な学術的議論が行われてきたが、 その主原因として触媒近傍で局所的に発生する非平衡高温場(ホットスポット)の存在が予想されている。本研究では、 マイクロ波によって触媒表面に発生すると考えられるホットスポットの存在を明確にし、そのメカニズムの解明と制御 を世界で初めて成功した。

研究成果の概要(英文): Acceleration of a large number of organic syntheses is no longer in doubt when these are carried out under microwave irradiation that provides the thermal energy as the driving force. Such elucidations must be pursued in more detail using different approaches, one of which might be the microwave-assisted organic synthesis of a product using a solid catalyst that might also be of interest and meaningful from the viewpoint of Green Chemistry. Hot spots that occur on a metallic catalyst surface subjected to microwave irradiation were recently examined by early research. By this research, the hot spot in the catalyst surface was checked and the explication of a mechanism and control were considered.

研究分野:マイクロ波化学、触媒

キーワード: マイクロ波化学 ホットスポット 固体触媒 有機合成

1.研究開始当初の背景

1990年代後半より、マイクロ波を用いた有 機合成の研究が盛んに行われている。マイク 口波を用いた有機合成は、既存加熱法(オイ ルバスなど)と同じ温度条件でも迅速に合成 が進むことが世界中で報告されてきた。しか し、Kappe らはこの迅速合成がマイクロ波法 における反応温度の測定法に問題があるこ とを指摘し(J. Org. Chem., 73 (2008) 63219)、 これにより温度測定が装置メーカーを中心 に見直された。現在では、この問題も改善さ れ、有機合成におけるマイクロ波加熱と既存 加熱法の厳密な比較追試実験が行われ、有機 合成の一部にのみ促進効果があることが再 確認された。中でも、金属触媒を用いた化学 合成は著しい促進効果が示唆されている。例 えば、マイクロ波加熱は既存加熱に比べ、鈴 ップリングでは 72 倍、溝呂木 Heck 反応では 27 倍、Stille カップリングでは 864 倍など の著しい反応時間の短縮が報告されている。 20 世紀の化学では触媒による化学反応効率 の向上が行われてきたが、マイクロ波加熱は これを更に促進させることができる。また、 このような迅速合成はグリーンケミストリ 一的な位置づけからも重要な技術であると 考えられる。一方、マイクロ波による金属触 媒能の促進理由(メカニズム)については 様々な学術的議論が行われてきたが、その主 原因として触媒近傍で局所的に発生する非 |平衡高温場(ホットスポット)の存在が予想 されている。

2.研究の目的

申請者らは、触媒表面に発生すると考えられるホットスポットの存在を探索してきた。 その探索研究の中で、申請者らが開発したマ イクロ波照射装置を用いて、パラジウム触媒 を担持した活性炭(Pd/AC)を用いた鈴木-宮 浦カップリングによる4-メチルビフェニル の合成を行うと、触媒表面でホットスポット が発生し、それをハイスピードカメラで撮影 することに世界で初めて成功した(*J. Phys. Chem. C.*, 115, (2011)23030)。この時の映 像から、マイクロ波照射開始後、直ちに微小 な黄色い光が触媒表面で点滅することが録 画された(図1)。



図 1 Pd/AC 触媒表面でのハイスピードカメ ラによるホットスポットの写真

これは触媒表面で微視的に発生するホットスポット(微細な高温場)で、マイクロ波による触媒反応を著しく促進させる正体であることを突き止めた。また、より高感度にホットスポットの撮影を行うため、高出力のマイクロ波を長時間連続照射していると、ホットスポットの熱によって活性炭表面の Pd 粒子が凝集を起こし(溶液の温度は 110)、それに伴い触媒活性が低下するため、合成効率が低下することが示された(図 2)。したがって、単にホットスポット(微視的な高温場)を発生させるだけではなく、それを制御することが反応の最適化につながることを示唆し



図 2 ホットスポットによる Pd の凝集

ホットスポットの発生因子として、マイク ロ波の電場・活性炭粒子(形状・サイズ・粒 子間距離)が重要であることを予想した。

そこで、本申請研究では、以下の点を実験することを目的とする。

(1) 触媒の観点から理論と実験によるホットスポットの発生条件を解明する。

(2) マイクロ波の電場や磁場に対するホッ トスポットの発生条件を解明する。

(3) 各発生条件に基づいたメカニズムの解 明と、モデル有機合成によるホットスポット 制御による反応の特徴の実証実験を行う。ま た、ホットスポット発生におけるシミュレー ション法を確立する。

3.研究の方法

ー連の実験を通し、活性炭パラジュウム触 媒(Pd/AC)を用いた鈴木-宮浦カップリング による 4-メチルビフェニルの合成をモデル 化学反応とした。

 $B(OH)_2 + Br - CH_3 - CH_3 - CH_3 + CH_3 +$ (1)no-4-methylt

マイクロ波による触媒のホットスポット の発生条件を、電磁界シミュレーターを用い た活性炭粒子間の電場強度を検討した。電磁 界 シ ミ ュ レ ー タ ー と し て COMSOL Multiphysicsを用い、模擬的に作成した活性 炭粒子をトルエンなどの溶媒中に分散させ、 2.45GHz マイクロ波を照射し、粒子間の位置 に対する電場の強度を可視化した。活性炭や 溶液の2.45GHz マイクロ波に対する誘電因子 (比誘電率や比誘電損失)をベクトル・ネット ワークアナライザ(平成25年度購入済み)で 実測し、そのデータを用いた電場強度のシミ ュレーションを行った。また、得られた結果 を実証するため、ガラスプレートへ様々な間 隔で活性炭粒子を固定化し、マイクロ波照射 によるホットスポットの発生条件を検討し た。

マイクロ波の成分である電場と磁場の強 度が変えられる装置を用いて(図 2)、マイク ロ波の電場や磁場に対するホットスポット の影響を検討した。さらに、ホットスポット の正体が、触媒表面で発生するマイクロプラ ズマであることを予想し、ホットスポットか ら発生する光を、分光学的に分析することで 温度を予想した。



図 2 電場と磁場の強度を変化させることの できるシングルモードマイクロ波照射装置 のイメージ

4.研究成果

ホットスポットの厳密な発生メカニズム を観察するため、活性炭(0.05g)をトルエン (5mL)に入れマイクロ波電場の照射を行いな がら、ハイスピードカメラによるホットスポ ットの連続観察を行った。マイクロ波の照射 に伴い、すぐに活性炭表面からは細かな気泡 が発生した(図 3a)。



図 3 ハイスピードカメラによる Pd/AC 分散 触媒におけるホットスポットの連続観測

この気泡はマイクロ波によって活性炭が

選択加熱されたためである。一方、活性炭粒 子は近くの別の活性炭粒子に、磁石で引き付 けられるように直線状に連結(凝集)した。そ の後、画面左下の連結した活性炭からオレン ジ色の光の点が観測された(図 3b)。その後、 活性炭表面での発光は大きくなり、光の周り では泡の数も増大した。更なるマイクロ波の 照射により活性炭は浮上し、発光も激しくな った(図 3c)。この浮上現象は活性炭表面の一 部がホットスポットで高温になり、活性炭近 傍のトルエンが気化され、その浮力で活性炭 が浮上したと考えられる。その後、ホットス ポットの光は最大強度で発光した(図 3d)。そ の後、ホットスポットから発生する光は消光 し、連結していた活性炭は液底に下降しなが ら分散した。トルエンの沸点は 110 である が、より高沸点(193)である無極性溶媒の シス体のデカリンでも同様な現象が確認さ れた。このことから、ホットスポットの温度 は 193 以上であることが予想される。

マイクロ波を照射した活性炭の挙動とし て、活性炭同士が引き合った後、ホットスポ ットが発生することが分かった。これは活性 炭表面でマイクロ波の電場による分極が生 じ、その分極による静電気的な吸着が原因で あると予想できる。そこで、この静電気的な 粒子の吸着とホットスポットの関係を検討 した。様々なサイズの活性炭を1粒だけトル エンに入れマイクロ波の電場照射を行った がホットスポットは発生しなかった。一方、 活性炭を2粒入れ、実験を行うと活性炭同士 が触れ合う瞬間にホットスポットが発生し た。したがって、ホットスポットは活性炭 -活性炭の間で発生することが予想された。活 性炭粒子間の位置関係に対するマイクロ波 (2.45GHz)の電場強度分布を COMSOL Multiphysics (Version 4.3a) を用いてシミ ュレートした。トルエン中に配置した 0.65 mm の活性炭粒子の間の距離を 0 mm、0.001 mm、 0.01 mm、0.1 mm の間隔で設定し電場の強度 をシミュレートした。

活性炭同士の距離が0mm(接地)では電界が 粒子の両端に分散し、活性炭表面の両端に最 大 813 V m⁻¹ の電場が集中した。一方、活性 炭間を 0.001 mm 離すと、電場は活性炭の隙 間に集中し最大で 11838 V m⁻¹ になった。活 性炭が完全に接地した状態に比べ 15.6 倍の 電界の集中が算出された。活性炭間の距離を 広げると最大電界強度は低下し、0.1 mm では 1253 Vm⁻¹であった。活性炭粒子サイズを0.95 mm に変化させ、同様なシミュレーションを行 ったが、活性炭間が狭いほど電界の集中度合 は最大になった。したがって、活性炭表面で 発生するホットスポットは粒子間の距離が 狭いほど発生しやすく、また活性炭同士が完 全に接合してしまうとホットスポットは発 生しなくなることが予想された。

粒子間の空間とホットスポットの発生の 相関関係に対するシミュレーション結果を 裏付けるため、活性炭粒子をガラスプレート 上に接着し、マイクロ波を照射すると0.01 mm の間隔でホットスポットの発生が観測され た。したがって、理論計算とほぼ一致し、約 0.01 mm がホットスポットを発生させる絶対 間隔であることが分かった。

ホットスポットの発生が活性炭粒子同士 の間で発生し、その絶対距離があることが分 かったため、これを防止するために撹拌をす ればよいことが予想できる。そこで、Pd/AC 触媒を分散させた溶液の各撹拌条件におけ るホットスポットの発生を検討した(図4)。0 rpm(無撹拌)条件では、容易にホットスポッ トが発生し、フラッシュ白光(図 4-i)と広域 オレンジ光(図 4-ii)が観測された。一方、500 rpm の条件では、オレンジ色の光がまれに発 光した。さらに、1500rpm 以上の撹拌条件で は、ほとんど観測されなかった。0 rpm で観 測された白とオレンジの光は、活性炭表面で 発生した温度に黒体放射から予測でき、白色 は>1400 程度、オレンジ色は 930 程度の 温度が活性炭表面で発生していると推定で きた。



図 4 ハイスピードカメラによる各撹拌条 件(0 または 1500 rpm)によるホットスピー ド発生の観察

マイクロ波を照射すると活性炭が自己連 結を始める。その原因を探るため電場や磁場 の照射方向に対する活性炭の連結について 検討した。電場や磁場の強度を変えることの できるマイクロ波導波管共振器の適切な位 置に試料を設置し、電場や磁場を照射した。 垂直の導波管の写真を図 5a-i に示す。導波 管内部では横方向に交番電場、縦方向に交番 磁場が存在していることから、反応容器に入 れたサンプルに対しても電場は水平方向か ら、磁場は垂直方向から印可される。電場照 射における活性炭の連結を図 5a-ii に示す。 ほとんどの活性炭は水平に連結しているこ とが示された。また、それらは積み重なった 状態で凝集した。一方、磁場照射下では円状 に活性炭が連結した(図 5a-iii)。リングは水 平に存在したが、写真撮影のために図 5a-iii ではリングを垂直に静置させた。磁場照射下 では磁場の方向を取り囲むように活性炭リ ングが形成した。また、リングのサイズは反 応容器の内径と一致した。そこで、三角柱状 の反応容器中における活性炭の連結を磁場 照射下で行った。予想通り、反応容器の内壁 に沿ってリングは形成した(図 5a-iv)。

導波管を水平に配置し、反応容器を上部から吊り下げ、マイクロ波の交番電場と交番磁場を照射した。導波管を水平に配置したことで、電場と磁場の方向は逆になる(図 5b-i)。

電場照射下では活性炭は電場の方向と同様 に、垂直に連結した(図 5b-ii)。図 5b-i には いくつかの垂直に連結した活性炭が沈んで いるものも確認される。一方、磁場照射下で は垂直にリングが形成した。垂直の導波管に よる磁場照射で生成した活性炭のリングは 強固であった。しかし、水平導波管の磁場照 射で形成したリングの結合力は強固ではな かった。したがって、マイクロ波照射を止め るとリングはすぐに下にうずくまった。





図 5 (a-i)縦置き導波管の写真および (a-ii)電場照射、(a-iii)磁場照射、(a-iv) 円錐状容器での磁場照射におけるトルエン 中の Pd/AC 触媒の連結の写真;(b-i)横置き 導波管の写真および(b-ii)電場照射、 (b-iii)磁場照射におけるトルエン中の Pd/AC 触媒の連結の写真

反応容器および溶液中に分散している Pd/AC 粒子に対する電場と磁場の印可の方向 を図 6 にまとめた。



図 6 電場または磁場照射に対する Pd/AC 粒子の電荷分布のイメージ

垂直の導波管に設置した導波管から吊る した容器に対して(図 5a-i の状態)、電場は 反応容器の側面から垂直に照射されるため、 活性炭粒子の両サイドの表面で分極が生じ る(図 6a)。このため、活性炭粒子は静電気的 に横の活性炭同士で結合する(図 5a-ii)。一 方、磁場下では反応溶液や活性炭が磁性を持 っていないため磁場による影響はない。しか し、反応容器に対して垂直な磁場からアンペ ールの右ねじの法則にしたがい、渦電流が円 を描くように発生する(図 6b)。この電場によ り活性炭粒子の左右に分極が生じ、活性炭同 士が結合する。活性炭は内壁に沿って粒子が 円状に結合する(図 5a-ii i and 5a-iv)。磁場 による活性炭の凝集は二次的電場の影響で あるため、より強いマイクロ波入力の照射が 必要である。

導波管を水平設置した実験では(図 5b-iの 状態)、電場は反応容器に対して垂直に存在 するため(図 6c)、活性炭の上下で分極が生じ る。したがって、活性炭は垂直に連結する(図 5b-ii)。一方、磁場照射下では磁場から発生 する渦電流によって円状形成する(図 6c)。し たがって、活性炭粒子は垂直な円に結合する ことが予想されるが、これは図 5b-ii と一致 する。

これらのイメージは、図6の実験値と非常 に一致する。したがって、活性炭の結合はマ イクロ波の電場によって分極が発生し、静電 気的粒子吸着で形成される。また、磁場から 発生した渦電流によっても間接的に粒子の 結合は形成される。一方、粒子同士が静電的 吸着で接近する過程で、ある最適な距離にお いてホットスポットが発生する。磁場であっ ても、そこから渦電流が発生するため同様に ホットスポットが発生する。

活性炭表面で生成するホットスポットは マイクロ波の電場によって主に形成した。ホ ットスポットが発生すると、ナノ粒子である 触媒が凝集し、活性が低下してしまう。さら にPa/AC固体触媒を用いた4-メチルビフェニ ルの合成では、ホットスポットが発生すると クロスカップリングに比べホモカップリン グが著しく低下する。

一方、磁場から発生する渦電流によっても 形成した。ホットスポットの形成には粒子間 の限りなく近い距離が重要な因子でありそ れらの制御をするには、撹拌が最適であると 予想できるが、これ以外に触媒を固定した反 応容器を用いることも有効である。化学プロ セスで固体触媒を用いる場合には、これらの 点を考慮して行う必要がある。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計33件)

<u>S. Horikoshi</u>, M. Kamata, S. Sakamoto, T. Mitani, N. Serpone, Control of microwave-generated hot spots. Part VI. Generation of hot spots in dispersed catalyst particulates and factors that affect catalyzed organic syntheses in heterogeneous media, Ind. Eng. Chem. Res.、査読有、53、2014、 14941-14947.

DOI: 10.1021/ie502169z

<u>S. Horikoshi</u>、N. Serpone、Role of microwaves in heterogeneous catalytic systems、Catal. Sci. Technol.、4、査 読有、4、2014、1197-1210. DOI:10.1039/c3cy00753g

S. Horikoshi, A. Osawa, S. Sakamoto, Control Ν. Serpone 、 ٥f Microwave-generated Hot Spots. Part V. Mechanisms of Hot-spot Generation and Aggregation of Catalyst in а Microwave-assisted Reaction in Toluene Catalyzed by Pd-loaded AC Particulates, Appl. Catal. A: General., 查読有、460-461、2013、52-60. DOI: 10.1016/j.apcata.2013.04.022

[学会発表](計31件)

鎌田桃子、<u>堀越</u>智、マイクロ波有機八 イドライド法における最適な触媒評価 に関する研究,2015年11月18日~11 月20日(20日発表)、第9回日本電磁 波エネルギー応用学会シンポジウム (上智大学開催)

〔図書〕(計7件)

<u>S. Horikoshi</u>, N. Serpone (Eds. and Author) , Microwaves in catalysis Methodology and applications , Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2015, 401 (1-28, 61-110, 259-280, 369-390)

〔産業財産権〕
出願状況(計1件)
名称:水素生成システム
発明者:堀越 智
権利者:学校法人上智学院
種類:特許
番号:特願 2015-115994
出願年月日:平成 27年6月8日
国内外の別: 国内

取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等 <u>http://pweb.cc.sophia.ac.jp/horikosi/</u>

 研究組織
 研究代表者
 堀越 智(HORIKOSHI, Satoshi)
 上智大学・理工学部・准教授 研究者番号: 50424784

(2)研究分担者 なし